

新製品情報

耐摩耗性を改善した新しいCMPリテーナリング用素材 ～ PPS(TECATRON CMP)、PEEK(TECAPEEK CMP)

シリコンウェハの前処理工程の中でも重要なプロセスの一つである化学機械研磨処理 (CMP) のリテーナリング用に特別開発いたしました新製品、TECATRON CMP と TECAPEEK CMP をご紹介いたします。

PPS素材：TECATRON CMP

新しいポリフェニレンサルファイド (PPS) 製のTECATRON CMPは、弊社従来製品よりも高い耐摩耗性を示します。スラリーなどに対する優れた耐薬品性と改善した摺動特性との相乗効果により、リテーナリングの部品寿命が延び、交換頻度を少なくすることができます。

PEEK素材：TECAPEEK CMP

タングステンなどのCMP処理では研磨条件が厳しく、PEEK製のTECAPEEK CMPが最適です。

この新製品は、PEEK樹脂の延性と寸法安定性に加えて、耐摩耗性も多いに改善しています。高いレベルの耐薬品性、機械特性の向上、摺動特性の改善の相乗効果により、リテーナリングの部品寿命を大きく向上させることができます。

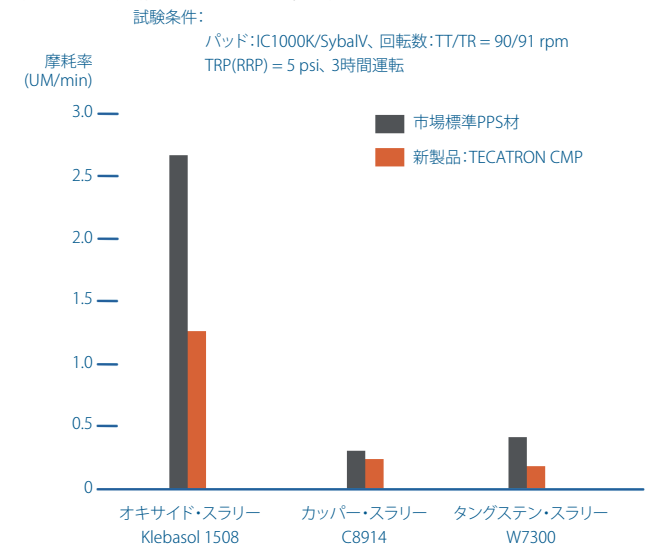
加工性の改善

これらの新製品は、切削加工性も多いに改善され、加工時間の短縮が可能です。またバリの発生量も従来品に比べて少なく、生産性の改善に寄与します。



実機評価データ

新しいPPSは、オキサイド・スラリーを用いた条件で市場標準PPSの約2倍の耐摩耗寿命を發揮しました。



面内均一性 (Within-Wafer-Nonuniformity: WIWNU) は、オキサイド・スラリーを用いた条件で、以下のように市場標準PPS材と同等かそれ以上の結果が得られています。

